# **Kinetic Effects in RF Discharges**

#### Philipp Hacker

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Physik

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

28. November 2017

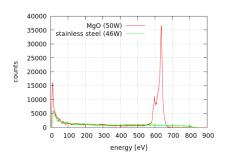
Betreuer: Prof. Dr. R. Schneider Gutachter: Prof. Dr. J. Meichsner

1. Motivation

- 2. Experiment
- 3. Particle-in-Cell Methode
- 4. 1D Simulation
- 5. Simulationen in 2D
- 6. Ausblick

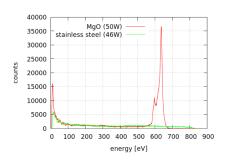


- Anwendung in Halbleiterund Computerchip-Industrie
- in elektronegativen CCRF-Entladungen treffen schnelle lonen auf die Elektroden
- Oberflächenprozesse an der Elektrode mit negativen lonen



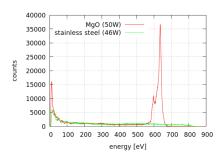


- Anwendung in Halbleiterund Computerchip-Industrie
- in elektronegativen CCRF-Entladungen treffen schnelle lonen auf die Elektroden
- Oberflächenprozesse an der Elektrode mit negativen lonen



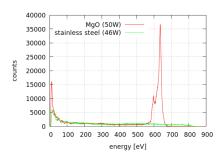


- Anwendung in Halbleiterund Computerchip-Industrie
- in elektronegativen CCRF-Entladungen treffen schnelle lonen auf die Elektroden
- Oberflächenprozesse an der Elektrode mit negativen lonen



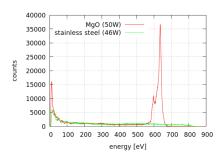


- Anwendung in Halbleiterund Computerchip-Industrie
- in elektronegativen CCRF-Entladungen treffen schnelle lonen auf die Elektroden
- Oberflächenprozesse an der Elektrode mit negativen lonen





- Anwendung in Halbleiterund Computerchip-Industrie
- in elektronegativen CCRF-Entladungen treffen schnelle lonen auf die Elektroden
- Oberflächenprozesse an der Elektrode mit negativen lonen



#### Randschichteffekte





## Oberflächen- und Stoßprozesse





## Das Experiment





#### Particle-in-Cell Methode





#### Monte-Carlo Stoßroutinen





#### 1D Simulation





## Energieverteilungen





## Dynamik negativer Ionen





#### Simulationen in 2D





## Vergleich mit 1D





## Negative Ionen EVF





## Asymmetrische Ranbedingungen





# Einfluss des Self Bias





## **Ausblick**



